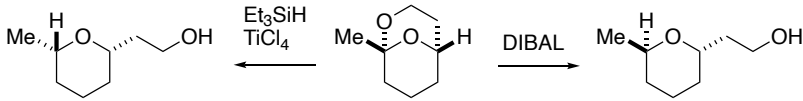


研究室

学籍番号

氏名

問 1. 以下の還元反応の立体選択性の違いを説明せよ。なお、 Et_3SiH は酸性条件下でも安定なヒドリド源(還元剤)である。



問 2. 次の還元反応が高立体選択的に進行する理由を説明せよ。

